ИЗВЕСТИЯ

ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА

Tom 254 1975

ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДА ТЕПЛОВОГО КВАЗИСТАЦИОНАРНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ К ЗАДАЧЕ ОБ ИСПАРЕНИИ МИКРОСЛОЯ

В. В. САЛОМАТОВ, А. Д. ГОРБУНОВ, А. В. КУЗЬМИН

(Представлена кафедрой теплофизики и атомной энергетики)

Гипотеза о микрослое, предложенная Снайдером [1], получила в последнее время широкое применение. В целом ряде работ сообщаются результаты косвенного термометрического и кинематографического доказательства существования микрослоя при помощи высокочувствительных термопар разной конструкции [1, 2, 4, 6], пленочных термометров сопротивления [5, 7], а также путем анализа осаждения радиоактивного сульфата кальция [3]. Прямое измерение толщины микрослоя было осуществлено с помощью оптического интерферометра [9]. В работе [10] тем же методом уточнены некоторые детали геометрии микрослоя с одновременным фотографированием роста пузырька.

Результаты вышеприведенных экспериментальных работ показали влияние испарения микрослоя на рост пузырька и теплообмен при кипении.

На пути полного аналитического описания процесса быстрого роста парового пузырька на поверхности раздела жидкость — твердое тело основную трудность представляет определение закона динамики испарения микрослоя. Поэтому приведенный в [13] анализ ограничен случаем однородного начального перегрева жидкости и твердого тела, имеющих одинаковые тепловые активности, для которого имеется точное решение [11].

В работе [14] дается численное решение одномерных уравнений теплопроводности, которое затем используется для определения объема

пара, образующегося в результате испарения микрослоя.

Цель работы — получение аналитического решения задачи об испарении микрослоя, необходимого для анализа участия его в росте парового пузырька и в механизме теплопереноса, а также для интерпретации экспериментальных данных по флуктуации температуры стенки.

Экспериментально определенные значения толщины микрослоя δ_0 , находящиеся в пределах 2—20 мк, на несколько порядков меньше текущего и отрывного радиусов пузырька, что дает основание остановиться на одномерной модели. Результаты работы [12] позволяют считать в первом приближении микрослой неподвижным.

K концу бурного начального роста пузырька на плоской стенке толщиной L формируется сверхтонкий слой жидкости толщиной $\eta = 1$. На внешней поверхности стенки действует поток $Ki(F_0)$. В начальный момент температура поверхности раздела твердое тело — жидкость равна

 $\Theta_2(0, 0) = 1.$

Принимается, что температура на границе раздела паровой и жидкой фаз постоянна во времени и равна $\Theta_2(\eta(F_0), F_0) = 0$. Градиент температуры в паре равен нулю. На поверхности раздела микрослой—стенка температура жидкости и твердого тела и соответствующие тепловые потоки равны. Начальные условия задаются распределением температуры в жидкости $u_2(Z_2)$ и твердом теле $u_1(Z_1)$.

С учетом исходных допущений рассматриваемая задача характери-

зуется следующей системой уравнений:

дифференциальное уравнение энергии в твердом теле

$$k_{\varepsilon}^{2} \frac{\partial \Theta_{1}(Z_{1}, F_{0})}{\partial F_{0}} = \frac{\partial^{2} \Theta_{1}(Z_{1}, F_{0})}{\partial Z_{1}^{2}}, F_{0} > 0. \ 0 < Z_{1} < L; \tag{1}$$

дифференциальное уравнение энергии в жидком микрослое

$$\frac{\partial \Theta_2(Z_2, F_0)}{\partial F_0} = \frac{\partial^2 \Theta_2(Z_2, F_0)}{\partial Z_2^2}, F_0 > 0, 0 < Z_2 < \eta(F_0);$$
 (2)

граничные условия на поверхности раздела жидкость—твердое тело

$$\Theta_1(0, F_0) = \Theta_2(0, F_0),$$
 (3)

$$\frac{\partial \Theta_1(0, F_0)}{\partial Z_1} = -\frac{\partial \Theta_2(0, F_0)}{\partial Z_2} \equiv q(F_0); \tag{4}$$

граничные условия на подвижной границе

$$\Theta_2(\eta(F_0), F_0) = 0 \tag{5}$$

$$\frac{\partial \Theta_2(\eta(F_0), F_0)}{\partial Z_2} = M \frac{d\eta(F_0)}{dF_0}; \tag{6}$$

На внешней поверхности стенки задано граничное условие второго рода

$$\frac{\partial \Theta_1(L, F_0)}{\partial Z_1} = \text{Ki}; (F_0). \tag{7}$$

Начальные условия

$$\Theta_1(Z_1, 0) = u_1(Z_1),$$
 (8)

$$\Theta_2(Z_2, 0) = u_2(Z_2),$$
 (9)

$$\gamma(0) = 1. \tag{10}$$

Рассматриваемая задача заключается в определении температурного поля и динамики образования паровой фазы. Отметим, что условие Стефана (6) делает задачу существенно нелинейной. Для решения дан-

ной задачи нелинейной теплопроводности с подвижной границей используем метод теплового квазистационарного приближения, получившего физическое обоснование и развитие в работах [15, 16], который позво-

ляет справиться с нелинейностью стефановского типа.

С учетом отмеченных физических особенностей протекания теплового процесса задачу, сформулированную системой уравнений (1)—(10), будем решать с помощью интегрального преобразования Лапласа. Освобождаясь от дифференциальных операций по времени и решая преобразованную задачу, возвращаясь в область оригиналов, выделим затем квазистационарную асимптотику температурного поля.

Численные оценки и сопоставления полученных результатов с точными решениями показывают, что для большинства нелинейных задач с подвижными границами использование двух членов разложения гаран-

тирует точность, достаточную для инженерных расчетов.

Тогда температурное поле для стенки с учетом двух членов разложения примет вид

$$\Theta_{1}(Z_{1}, F_{0}) = \frac{1}{k_{\varepsilon}^{2} L} \int_{0}^{F_{0}} (K_{1} - q) dF_{0} + q L \left(\frac{1 - 3\left(\frac{Z_{1} - L}{L}\right)^{2}}{6}\right) - K_{i} L \left(\frac{1 - 3\left(\frac{Z_{1}}{L}\right)^{2}}{6}\right) + \frac{1}{L} \int_{0}^{L} u_{1}(Z_{1}) dZ_{1}.$$
(11)

Используя приведенную процедуру, получим решение для микрослоя

$$\Theta_{2}(Z_{2}, F_{0}) = \frac{1}{\eta} \int_{0}^{F_{0}} (V+q) dF_{0} - V \eta \left(\frac{1 - 3\left(\frac{Z_{2}}{\eta}\right)^{2}}{6} \right) - q \eta \left(\frac{1 - 3\left(\frac{Z_{2} - \eta}{\eta}\right)^{2}}{6} \right) + \frac{1}{\eta} \int_{0}^{\eta} u_{2}(Z_{2}) dZ_{2}, \tag{12}$$

где

 $V_{\rm c}(F_0) = M\eta_{\rm c}(F_0)$ (точка означает диффернециирование по времени), В решении (11) — (12) остается пока неизвестным закон движения границы раздела фаз $\eta_{\rm c}(F_0)$ и функция теплового потока на границе раздела жидкость—твердое тело $q_{\rm c}(F_0)$. Удовлетворяя соответственно условиям (3) и (5), получим систему интегро-дифференциальных уравнений для их определения

$$\frac{1}{k_{\varepsilon}^{2}L} \int_{0}^{F_{0}} (K_{i}-q) dF_{0} - \frac{qL}{3} - \frac{K_{i}L}{6} + v_{2} = \frac{1}{\eta} \int_{0}^{F_{0}} (V+q) dF_{0} - \frac{V\eta}{6} + \frac{q\eta}{3} + v_{2}, \quad (13)$$

$$\frac{1}{\eta} \int_{0}^{F_{0}} (V+q) dF_{0} = \frac{q \eta}{6} - \frac{V \eta}{3} - v_{2}, \tag{14}$$

где

$$v_1 = \frac{1}{L} \int_0^L u_1(Z_1) dZ_1; \qquad v_2 = \frac{1}{\eta} \int_0^{\eta} u_2(Z_2) dZ_2. \tag{15}$$

Методы решения интегро-дифференциальных уравнений разработаны гораздо хуже, чем дифференциальных или интегральных. Трудности,

возникающие при решении интегро-дифференциальных уравнений, можно обойти, сводя их к интегральному уравнению Вольтерра второго рода.

Для этого удовлетворим уравнению теплопроводности (2) при Z_2 η . Получим уравнение второй степени относительно V, решение которого имеет вид

$$V = -\frac{M}{2\eta} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{q\eta}{M}} \right). \tag{15}$$

С учетом выражения (15) решение уравнения (13), описывающего закон движения границы раздела фаз, запишется как

$$\widetilde{F}_{0} = N(F_{0})(1 - \eta(F_{0})) - \frac{v_{2}^{*}}{\text{Ki}(F_{0})} + \frac{k_{\epsilon}^{2}L^{2}}{6} - \frac{k_{\epsilon}^{2}Lv_{1}}{\text{Ki}(F_{0})} + \frac{q(F_{0})}{\text{Ki}(F_{0})} \left(\frac{\eta^{2}(F_{0})}{6} + \frac{k_{\epsilon}^{2}L^{2}}{3} + \frac{\eta(F_{0})k_{\epsilon}^{2}L}{2}\right) - \frac{V(F_{0})}{\text{Ki}(F_{0})} \left(\frac{\eta(F_{0})}{3} + \frac{\eta(F_{0})k_{\epsilon}^{2}L}{2}\right), \tag{16}$$

где функция q(F₀) определяется из решения уравнения

$$\int_{0}^{F_{0}} q(F_{0}) dF_{0} = \frac{q \eta^{2}}{6} - \frac{V \eta^{2}}{3} - M(\eta - 1) - v_{2}^{*}.$$
 (17)

1

Здесь и далее

$$v_2^* \int_0^1 u_2(Z_2) dZ_2.$$

Интегральное уравнение (17) является весьма сложным для вычисления функции $\eta(F_0)$, но в некоторых предельных случаях, весьма интересных в практическом приложении, оно может быть значительно упрощено. Ниже мы рассмотрим основные из них.

Следует заметить, что для проведения анализа о роли испаряющего микрослоя в динамике парового пузырька желательно получить как можно более простые аналитические выражения для закона движения границы фазового перехода $\eta(F_0)$, чтобы упростить проведение общего анализа по участию испаряющегося микрослоя в механизме переноса тепла и динамике растущего на поверхности нагрева парового пузырька.

Выражения для нахождения поля температур можно записать в более простом виде. Используя уравнение динамики процесса (13), (14), перепишем выражения (11), (12) в более простой форме

$$\Theta_{1}(Z_{1}F_{0}) = \frac{\eta}{2}(q - V) + \frac{qL}{2} \left[1 - \left(\frac{Z_{1} - L}{L}\right)^{2} \right] + \frac{\text{Ki}}{2} \frac{Z_{1}^{2}}{L}, \tag{18}$$

$$\Theta_2(Z_2, \mathcal{F}_0) = \frac{q}{2\eta} (Z_2 - \eta)^2 + \frac{V}{2\eta} Z_2^2 - \frac{V\eta}{2}. \tag{19}$$

Случай $k_{\varepsilon}^2 \longrightarrow 0$. Равенство $k_{\varepsilon}^2 = 0$ означает, что тепловая активность жидкости преобладает над тепловой активностью материала стенки. Твердая стенка является как бы «прозрачной» для теплового потока, иными словами $q(F_0) = K_1(F_0)$. Действительно, при умножении первого интегро-дифференциального уравнения (13) на $k_{\varepsilon}^2 = 0$ получим

$$\frac{1}{L} \int_{0}^{F_{0}} (Ki(F_{0}) - q(F_{0})) dF_{0} = 0,$$

$$Ki(F_0)=q(F_0)$$

Практическим примером может служить кипение неметаллических жидкостей на материалах, близких по теплофизическим свойствам к изоляторам.

Тогда закон движения границы фазового перехода получим из (16)

$$\widetilde{F}_0 = N(1 - \eta(F_0)) - \frac{v_2^*}{Ki(F_0)} + \frac{\eta^2(F_0)}{6} - \frac{v(F_0)}{Ki(F_0)} \frac{\eta^2(F_0)}{3}.$$
 (20)

Определенный интерес представляет полное время испарения микрослоя, которое определится из (20) при $\eta(F_{0k}) = 0$

$$\widetilde{F}_{0\kappa} = N(F_0) - \frac{v_2^*}{\text{Ki}(F_0)}. \tag{21}$$

Для определения флуктуации температуры поверхности нагрева под растущим паровым пузырьком можно воспользоваться любым из уравнений (18) и (19)

$$\Theta_1(0, F_0) = \frac{\eta(F_0)}{2} (Ki(F_0) - V(F_0)),$$
 (22)

В случае $\frac{4 \text{Ki}(F_0) \eta(F_0)}{M} \ll \text{I}$ выражения (15), (20), (22) можно еще

более упростить, не опасаясь потери точности, разложив подкоренное выражение в (15) в ряд и ограничиваясь первым членом ряда

$$\begin{array}{c}
V(F_0) \cong Ki(F_0), \\
\widetilde{F}_0 \cong N(F_0)(1 - \eta(F_0)) - \frac{\mathfrak{v}_2^*}{Ki(F_0)} + \frac{\eta^2(F_0)}{2}, \\
\Theta_1(0, F_0) \cong \eta(F_0) \cdot Ki(F_0).
\end{array}$$
(23)

Случай $k_{\varepsilon}^2 \longrightarrow \infty$. Этому случаю соответствует, например, кипение органических жидкостей на высокотеплопроводных металлических поверхностях нагрева. Он означает, что тепловая активность материала стенки намного больше тепловой активности кипящей жидкости. Характерной особенностью процесса при $K_{\varepsilon}^2 \longrightarrow \infty$ является постоянство температуры поверхности нагрева на всем протяжении процесса испарения микрослоя.

Записав уравнение (13) в виде

$$\frac{1}{\eta(\mathbf{F}_0)} \int_0^{\mathbf{F}_0} (V+q) d\mathbf{F}_0 - \frac{V \eta(\mathbf{F}_0)}{6} + \frac{q \eta(\mathbf{F}_0)}{3} + v_2 = 1$$
 (24)

и решая систему (14), (24) с привлечением дополнительной связи (15) при начальных распределениях, близких к линейным, получим следующее уравнение динамики процесса испарения

$$1 - \eta^{2}(F_{0}) = 2\left(1 - \sqrt{\frac{M-2}{M}}\right)F_{0}. \tag{25}$$

Выражение для определения времени окончания процесса испарения примет следующий вид

$$F_{0\kappa} = \frac{1}{2\left(1 - \sqrt{\frac{M-2}{M}}\right)}.$$
 (26)

Интересно отметить, что из уравнений (25), (26) для случая $k_{\mathfrak{s}}^2 \longrightarrow \infty$ вытекает область решения полученных соотношений M > 2.

Для слабоменяющихся по времени тепловых потоков при $Ki(F_0) \cong$

const модифицированное число Фурье F₀ переходит в F₀.

Из анализа динамики процесса испарения вытекает, что основную роль играет первый член выражения (20), т. е. критерий $N(F_0)$. Очевидно, что регуляризация кинетики процесса будет протекать тем быстрее, чем больше будет относительный критерий испарения $N(F_0)$.

Авторы работы [14] провели численные расчеты на ЭЦВМ при постоянных тепловых потоках и линейном начальном распределении температурного поля вида: для стенки $u_1 = 1 + \text{Ki}Z_1$ для жидкого микрослоя

 $u_2=1-\mathrm{Ki}Z_2$.

К сожалению, представлены результаты расчетов только для двух

частных значений критерия Кі, равных 0,03 и 0,3.

Из сопоставления с численными расчетами [14] следует, что с ростом Кі и для достаточно больших значений критерия М выражения (20) и (25) будут давать соответственно верхнюю и нижнюю оценку динамики процесса, что удобно для проведения анализа по участию микрослоя в росте пузыря и передачи тепла.

Из сопоставления решений и анализа полученных аналитических выражений можно видеть, что для обоих случаев k^2 решения становятся автомодельными относительно безразмерной толщины пластины L и практически совпадают с результатами численных расчетов для системы ограниченного и полуограниченного тел по динамике испарения микрослоя и по флуктуации температуры поверхности нагрева в квазистационарной части процесса.

Начальная стадия оказывает влияние на динамику процесса испарения при малых значениях критерия фазового перехода M, но это влияние не существенно. Так как при $M\!=\!5$ за этот отрезок времени испаряется всего около 20% микрослоя, при значениях $M\!>\!100$ величина испа-

рившегося слоя жидкости составит менее 1%.

В случае необходимости начальную стадию процесса можно учесть введением «глубины проникновения теплового возмущения» со стороны границы фазового перехода [16].

Выводы

1. С помощью метода теплового квазистационарного приближения получено общее решение задачи об испарении микрослоя при произвольных начальных распределениях температур в стенке и в жидком микрослое и произвольном тепловом потоке на нагревающей стенке.

2. Проведенный анализ позволил выделить из общего довольно сложного решения асимптотически точные и приближенные расчетные соотношения по динамике испарения микрослоя, флуктуации поверхности нагрева, времени полного испарения микрослоя при предельных значениях режимных параметров.

3. Сопоставление полученных решений с некоторыми частными результатами численных расчетов показывает хорошую сходимость в квазистационарной части процесса испарения микрослоя.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

$$\Theta = \frac{T - T_s}{T_{10} - T_s} \qquad \qquad - \text{безразмерная температура;}$$

$$\tau_{(F_0)} = \frac{\delta(\tau)}{\delta_0}; \quad L = \frac{l}{\delta_0} \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \qquad - \text{безразмерные толщины микрослоя и стен-ки;}$$

$$Z_2 = \frac{Z_1}{\delta_0}; \quad Z_1 = \frac{Z_1\lambda_1}{\delta_0\lambda_2} \qquad - \text{безразмерные координаты;}$$

$$F_0 = \frac{a_2\tau}{\delta_0^2} \qquad \qquad - \text{число } \Phi_{\text{урье, отсчитываемое от начала установления температуры стенки, равной } T_{10};$$

$$M = \frac{r}{Cp_2(T_{10} - T_s)} \qquad - \text{критерий фазового превращения;}$$

$$Ki(F_0) = \frac{q_1(\tau)\delta_0}{\lambda_2(T_{10} - T_s)} \qquad - \text{критерий Кирпичева;}$$

$$k_z^2 = \frac{\lambda_1\rho_1C\rho_1}{\lambda_2\rho_2C\rho_2} \qquad - \text{критерий, характеризующий тепловую активность материала стенки по отношению к жиккости;}$$

$$a_1, \lambda_1, \rho_1, C\rho_1, l \qquad - \text{температуропроводность, теплопроводность, теплопроводность, теплопероводность, теплопероводность$$

ЛИТЕРАТУРА

- 1. F. D. Moore, R. B. Mesler. A. I. Ch. E. H., vol., 7, 620, 1961.
- 2. T. E. Rogers, R. B. Mesler. A. I. Ch. E. H., vol. 10, 656, 1964.
- 3. N. B. Hospeti, R. B. Mesler. A. I. Ch. E. H., vol. 11, 663, 1965.
- 4. R. Morin. "Symposium of Two Phase Flow, Department of Chemical Engineering, University of Exeter Devon, England Summanries", Iule, 1965.
 - 5. G. E. Foltz, R. B. Mesler. A. I. Ch. E. H., vol. 16, 44, 1970.
 - 6. N. B. Hospeti, R. B. Mesler. A. I. Ch. E. H., vol. 15, 214, 1969.
 - 7. M. D. Cooper, A. I. Lloyd. Int. H. Heat Mass Transfer. vol. .12, 915, 1969.
- 8. В. И. Толубинский, А. А. Кривешко, Ю. Н. Островский. Сб. «Теплофизика и теплотехника», № 19, 1971.

- 9. R. R. Sharp. NACA TND 1997, 1964.
- 10. H. H. Jawurek. Int. H. Heat Mass Transfer, vol. 12, 843, 1969.
- 11. Г. Карслоу, Д. Егер. Теплопроводность твердых тел. «Наука», М., 1964. 12. Ү. Каtto, М. Shoju. Int. H. Heat Mass Transfer, vol. 13, 1299, 1970.
- 13. H. I. Van Ouwerkerk. "The Role of the Evaporating Microlayer and Dry Surface Areas in Boiling". Drukkerij Demmenie N. V.- Leiden, 1970.
- 14. М. Г. Купер, Дж. М. Мерри. Тепло- и массоперенос, том. 9, часть І, стр. 233. Минск, 1972.
 - 15. В. В. Саломатов. Изв АН СССР, Энергетика и транспорт, 1970, № 3.
- 16. В. В. Саломатов, А. Д. Горбунов. Изв. АН СССР, Энергетика и транспорт, 1972, № 1.